

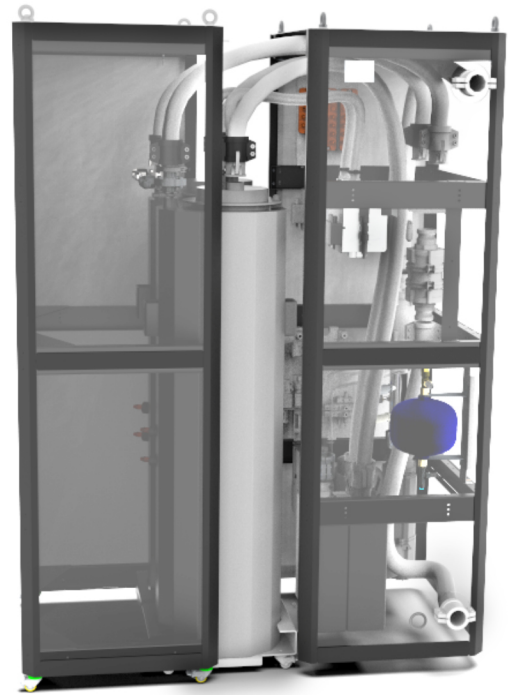


AMF 200



Gasreinigungssystem für den metallischen 3D-Druck

- Modulares, offenes und durch Einsatz von Standardkomponenten kostenoptimiertes System zu Prozessgasreinigung
- Volumenstrom bis 200 m³/h bei Unterdruck 10.500 Pa (N₂, 50°C) / 15.000 Pa (Ar, 50°C) und Anschlussleistung 2,2 kW
- Skalierte Anlagen mit mehreren Modulen ermöglichen größere Volumenströme
- Filterzellengröße optional nach Staublast wählbar
- Filterreinigung via Jet-Impuls
- Betrieb mit oder ohne Dosierung von Filterhilfsmittel möglich
- Hohe Sicherheit und hohes Containment bei Entnahme verbrauchter Filterzellen
- Simples Handling
- Steuerungstechnischer Betrieb als Slave mit IO-System oder als eigenständige Maschine mit eigener Steuerung
- Geringe Stellfläche



Ausstattung:

- Rahmen mit Gehäuse auf Rollen (Platzbedarf BxTxH 800 x 1.200 x 2.000 mm)
- Standard: 2 Filterzellen mit je 5 m² Filterfläche und Staubsammelvolumen bis 60 l
- Größere Filterzellen mit je 10 m² Filterfläche möglich (Gesamtbreite von 800 auf 1.000 mm)
- Filterreinigungssystem
- 1 Polizeifilter (Filterzelle)
- Seitenkanal-Verdichter mit aufgesatteltem Frequenzumrichter
- Verschiedenste Sensorik (Differenzdruck Filterstufen, Füllstand Filterzelle, Sauerstoff, Volumenstrom, Temperatur)
- Absperrung Prozessgas-Inlet, -Outlet (Quetschventile)
- Feldbus-Module

